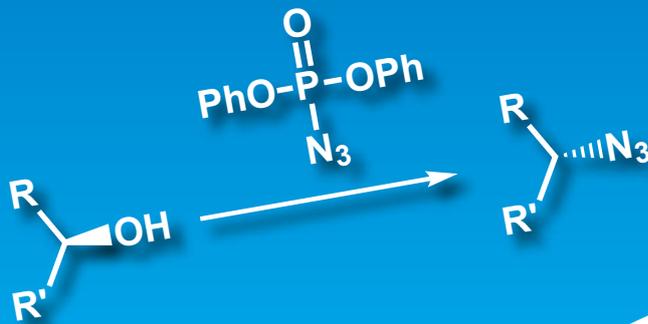
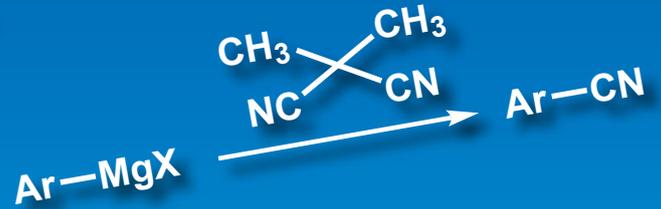
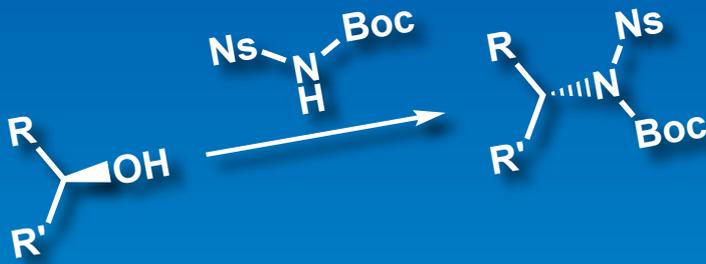


C-N結合形成反応

C-N Bond Formation Reactions



アミノ化試薬

ニトロ化試薬

シアノ化試薬

アジド化・ジアゾ化試薬

グアニジニル化試薬

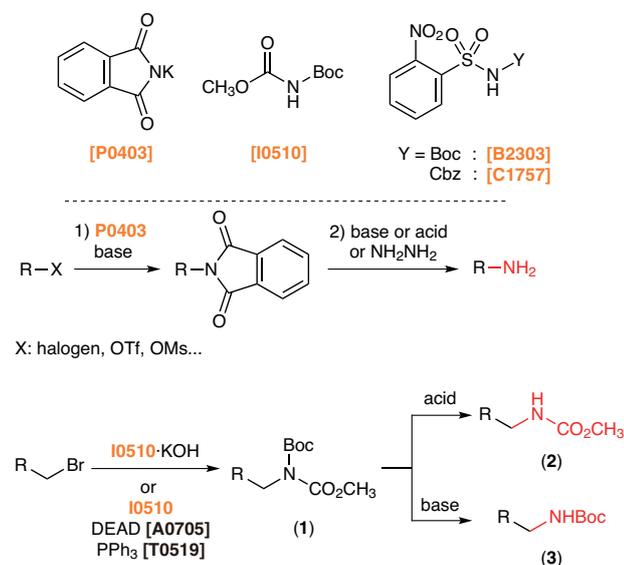
C-N結合形成反応

含窒素化合物は、アミノ酸や核酸、アルカロイドなどの天然物から医薬品や電子材料やポリアミドのような合成化合物まで、極めて幅広い場面で見られます。また、含窒素官能基もアミノ基やニトロ基など、結合様式から酸化状態まで様々なものが知られています。そのため、C-N結合形成反応も導入する官能基によって変わってきます。

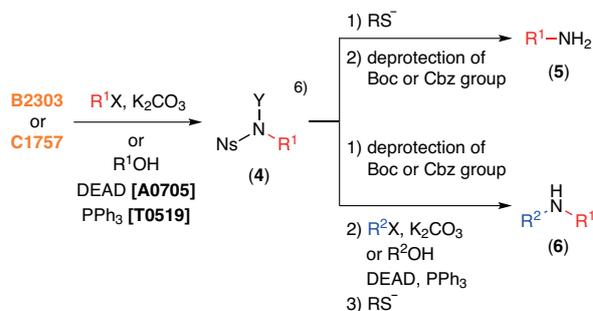
C-N結合形成反応は単純な官能基導入から複素環の構築まで多岐にわたっているため網羅的な紹介は難しいですが、本パンフレットでは弊社で取り扱っているC-N結合形成に用いられる試薬の中で、特に含窒素官能基を導入する試薬を収載しています。有機合成研究の一助としてお役立てください。なお、C-N結合形成とは言い難いシアノ化剤も紹介していますが、シアノ基は他の含窒素官能基に変換できるため、ここで紹介しております。

●アミノ化

求核的なアミノ化反応としてGabrielアミン合成¹⁾は広く使用されており、フタルイミドカリウム[P0403]や類似のアミノ化剤も数多く報告されています。イミノジカルボン酸 *tert*-ブチルメチル[I0510]のカリウム塩はアルキルハライドと反応し、イミド(1)を生成します²⁾。1を酸で処理すると*N*-メトキシカルボニルアミン(2)を、塩基で処理すると*N*-Bocアミン(3)を得ることができます。また、I0510は光延反応にも適用でき、水酸基をアミノ基に変換できます³⁾。



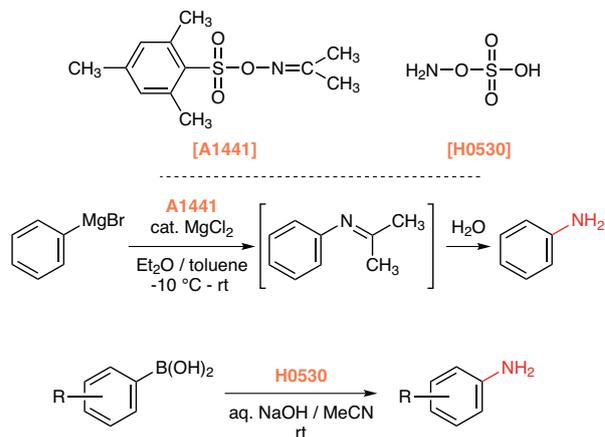
一方、福山らは*o*-ニトロベンゼンスルホニル基(Ns基)で保護したスルホンアミド [B2303][C1757]を用いたアミン合成法を報告しています⁴⁾。これらもI0510と同様に塩基性条件下でアルキルハライドと、光延条件下でアルコールとそれぞれ反応し、アミノ化体(4)を与えます。4の各保護基は選択的に脱保護でき、両保護基を脱保護すると第一級アミン(5)を、Ns基を残して再度アルキル化し、脱保護すると第二級アミン(6)がそれぞれ高収率で得られます⁵⁾。

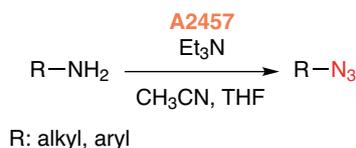
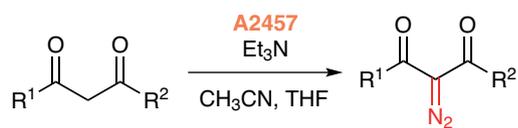


一方、求電子的なアミノ化剤としてはアセトキシム *O*-(2,4,6-トリメチルフェニル)スルホナート [A1441]が挙げられます⁶⁾。

A1441は触媒量の塩化マグネシウムの存在下、Grignard試薬と反応し、良好な収率で第一級アミンを生成します⁷⁾。

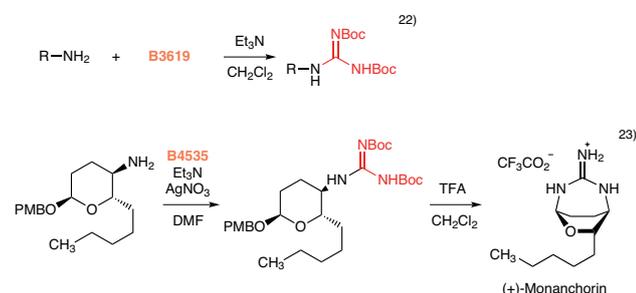
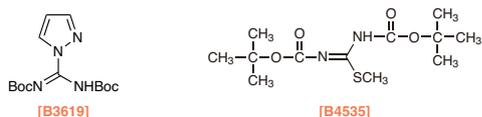
さらに、ヒドロキシルアミン-*O*-スルホン酸(HSA)[H0530]もアミノ基を導入する試薬として有用です。HSAはアミノカチオン等価体として挙動し、フェニルボロン酸誘導体に作用させると第一級アニリンを与えます。本反応は簡便な操作かつ遷移金属フリーで進行することも特長です⁸⁾。





●グアニジニル化

グアニジン構造は有機塩基の中でも強い塩基性を持ち、アルギニンにも見られるだけでなく、生理活性物質においても多く見られます。例えば、サキシトキシンやテトロドトキシンなどのフグ毒由来の成分や、海綿由来のHIV阻害化合物バツェラジンAなどは、主要構造にグアニジノ基を有しています。また、抗菌剤や抗マラリア剤などの医薬品においても、グアニジン構造が見られます。そのため、創薬研究においてもグアニジン類の合成にグアニジニル化剤が利用されています²¹⁾。グアニジニル基は、主にアミノ基への付加反応で導入されます。

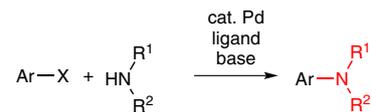


●クロスカップリング反応によるC-N結合形成

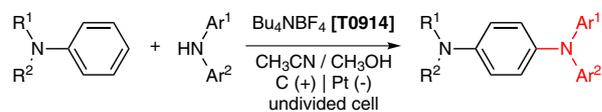
Buchwald²⁴⁾とHartwig²⁵⁾は、パラジウム触媒と強塩基存在下、アミンとアリールハライドを作用させると、カップリング体が高収率で得られることを見出しました。この反応は、単に置換基としてのアミノ基を導入するだけでなく、含窒素複素環の構築にも適用できます。そのため、天然物合成や創薬研究、プロセス開発において幅広く用いられています²⁶⁾。

また、近年、電解酸化によるC-Nクロスカップリングが報告されました²⁷⁾。この反応はパラ位選択的にクロスカップリングが進行すること、金属触媒フリーで進行すること、C-H活性化を経てカップリングが進行するため、唯一の副生成物が水素ガスで環境負荷が小さいという利点があります。

Buchwald-Hartwig cross-coupling



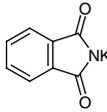
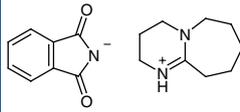
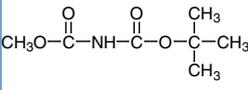
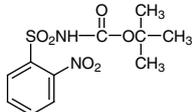
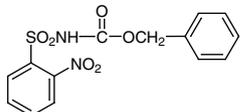
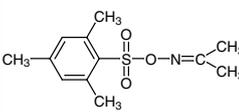
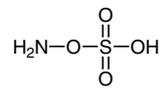
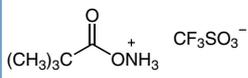
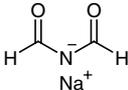
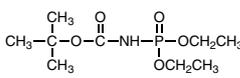
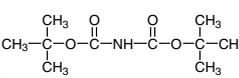
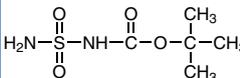
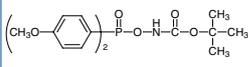
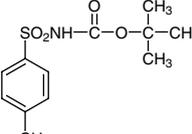
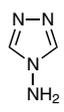
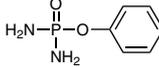
Electrooxidative C-N cross-coupling



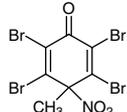
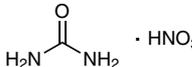
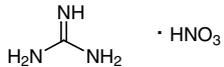
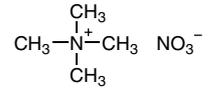
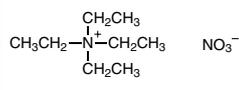
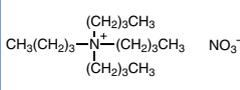
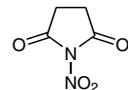
文 献

- 1) a) S. Gabriel, *Ber.* **1887**, 20, 2224.
b) M. S. Gibson, R. W. Bradshaw, *Angew. Chem. Int. Ed.* **1968**, 7, 919.
- 2) a) J. D. Elliott, J. H. Jones, *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1977**, 758.
b) C. T. Clarke, J. D. Elliott, J. H. Jones, *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1978**, 1088.
- 3) J. M. Chong, S. B. Park, *J. Org. Chem.* **1993**, 58, 7300.
- 4) T. Fukuyama, M. Cheung, T. Kan, *Synlett* **1999**, 1301.
- 5) T. Kan, A. Fujiwara, H. Kobayashi, T. Fukuyama, *Tetrahedron* **2002**, 58, 6267.
- 6) E. Erdik, M. Ay, *Syn. React. Inorg. Met.* **1988**, 19, 663.
- 7) E. Erdik, *e-EROS* **2001**.
- 8) S. Voth, J. W. Hollett, J. A. McCubbin, *J. Org. Chem.* **2015**, 80, 2545.
- 9) a) M. Lemaire, A. Guy, J. Roussel, J.-P. Guette, *Tetrahedron* **1987**, 43, 835.
b) M. Lemaire, A. Guy, P. Boutin, J.-P. Guette, *Synthesis* **1989**, 761.
- 10) R. G. Coombes, J. H. Ridd, *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1992**, 174.
- 11) Z. Zhang, L. S. Liebeskind, *Org. Lett.* **2006**, 8, 4331.
- 12) S. Zheng, C. Yu, Z. Shen, *Org. Lett.* **2012**, 14, 3644.
- 13) J. Peng, J. Zhao, Z. Hu, D. Liang, J. Huang, Q. Zhu, *Org. Lett.* **2012**, 14, 4966.
- 14) K. J. Powell, L.-C. Han, P. Sharma, J. E. Moses, *Org. Lett.* **2014**, 16, 2158.
- 15) Y. Zhu, M. Zhao, W. Lu, L. Li, Z. Shen, *Org. Lett.* **2015**, 17, 2602.
- 16) a) J. T. Reeves, C. A. Malapit, F. G. Buono, K. P. Sidhu, M. A. Marsini, C. A. Sader, K. R. Fandrick, C. A. Busacca, C. H. Senanayake, *J. Am. Chem. Soc.* **2015**, 137, 9481.
b) C. A. Malapit, I. K. Luvaga, J. T. Reeves, I. Volchkov, C. A. Busacca, A. R. Howell, C. H. Senanayake, *J. Org. Chem.* **2017**, 82, 4993.
- 17) K. Ninomiya, T. Shioiri, S. Yamada, *Tetrahedron* **1974**, 30, 2151.
- 18) T. Shioiri, K. Ninomiya, S. Yamada, *J. Am. Chem. Soc.* **1972**, 94, 6203.
- 19) M. Kitamura, N. Tashiro, S. Miyagawa, T. Okauchi, *Synthesis* **2011**, 1037.
- 20) M. Kitamura, M. Yano, N. Tashiro, S. Miyagawa, M. Sando, T. Okauchi, *Eur. J. Org. Chem.* **2011**, 458.
- 21) A. Mishra, S. Batra, *Curr. Top. Med. Chem.* **2013**, 13, 2011.
- 22) M. S. Bernatowicz, Y. Wu, G. R. Matsueda, *Tetrahedron Lett.* **1993**, 34, 3389.
- 23) Y. Ma, G. A. O'Doherty, *Org. Lett.* **2015**, 17, 5280.
- 24) A. S. Guram, R. A. Rennels, S. L. Buchwald, *Angew. Chem. Int. Ed.* **1995**, 34, 1348.
- 25) J. Louie, J. F. Hartwig, *Tetrahedron Lett.* **1995**, 36, 3609.
- 26) Review: P. Ruiz-Castillo, S. L. Buchwald, *Chem. Rev.* **2016**, 116, 12654.
- 27) K. Liu, S. Tang, T. Wu, S. Wang, M. Zou, H. Cong, A. Lei, *Nat. Commun.* **2019**, 10, 639.

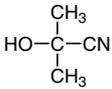
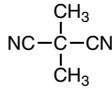
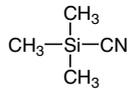
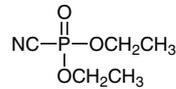
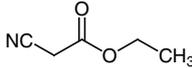
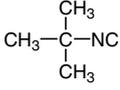
アミノ化試薬

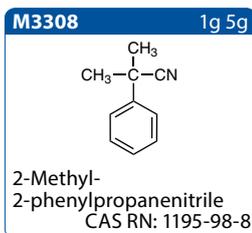
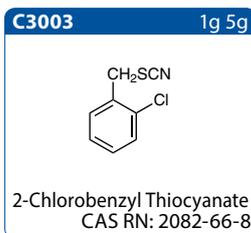
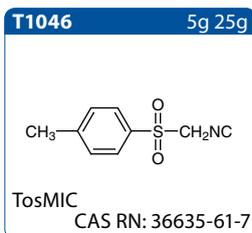
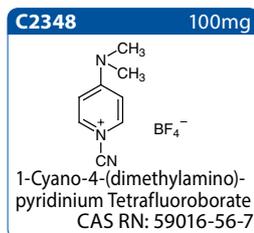
		P0403 25g 500g  Phthalimide Potassium Salt CAS RN: 1074-82-4	P1235 25g  Phthalimide DBU Salt CAS RN: 119812-51-0	I0510 5g  <i>tert</i> -Butyl Methyl Iminodicarboxylate CAS RN: 66389-76-2
B2303 1g 5g 25g  <i>N</i> -Boc-2-nitrobenzenesulfonamide CAS RN: 198572-71-3	C1757 5g 25g  <i>N</i> -Cbz-2-nitrobenzenesulfonamide CAS RN: 245365-64-4	A1441 5g 25g  Acetoxime <i>O</i> -(2,4,6-Trimethylphenyl)sulfonate) CAS RN: 81549-07-7	H0530 25g 100g 500g  Hydroxylamine- <i>O</i> -sulfonic Acid CAS RN: 2950-43-8	P2856 1g  <i>O</i> -Pivaloylhydroxylammonium Triflate CAS RN: 1293990-73-4
D2479 25g  Sodium Diformylamide CAS RN: 18197-26-7	B1734 1g 5g  <i>N</i> -Boc-phosphoramidic Acid Diethyl Ester CAS RN: 85232-02-6	I0497 5g 25g  Di- <i>tert</i> -butyl Iminodicarboxylate CAS RN: 51779-32-9	B5402 1g 5g  <i>tert</i> -Butyl Sulfamoylcarbamate CAS RN: 148017-28-1	B2857 1g 5g  <i>tert</i> -Butyl [Bis(4-methoxyphenyl)-phosphinyloxy]carbamate CAS RN: 619333-95-8
B1648 10g 25g  <i>N</i> -Boc- <i>p</i> -toluenesulfonamide CAS RN: 18303-04-3	A1137 25g 250g  4-Amino-1,2,4-triazole CAS RN: 584-13-4	P2909 1g 5g  Phenyl Phosphorodiamidate CAS RN: 7450-69-3		

ニトロ化試薬

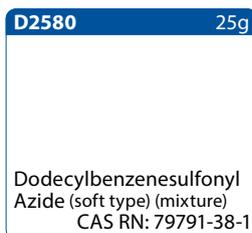
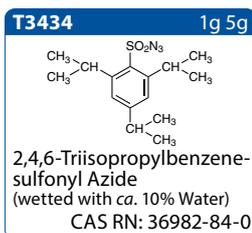
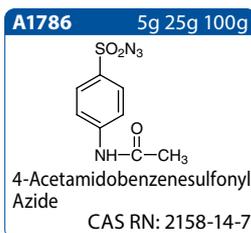
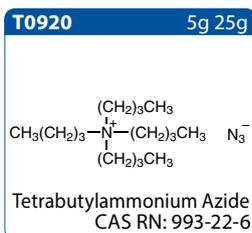
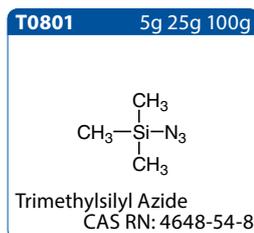
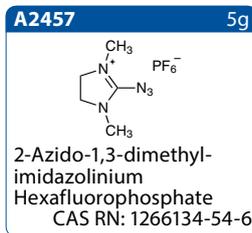
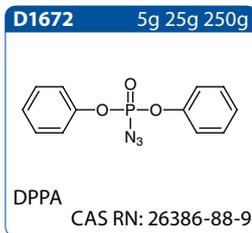
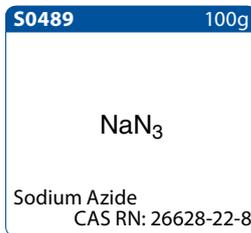
		T1431 5g 25g  2,3,5,6-Tetrabromo-4-methyl-4-nitro-2,5-cyclohexadien-1-one CAS RN: 95111-49-2	N0806 300mL HNO ₃ Nitric Acid (67%) CAS RN: 7697-37-2	U0015 25g  Urea Nitrate (wetted with ca. 25% Water) CAS RN: 124-47-0
G0164 25g  Guanidine Nitrate CAS RN: 506-93-4	T4131 5g 25g  Tetramethylammonium Nitrate CAS RN: 1941-24-8	T3082 5g 25g  Tetraethylammonium Nitrate CAS RN: 1941-26-0	T3651 5g 25g  Tetrabutylammonium Nitrate CAS RN: 1941-27-1	N1193 1g  <i>N</i> -Nitrosuccinimide CAS RN: 5336-95-8

シアノ化試薬

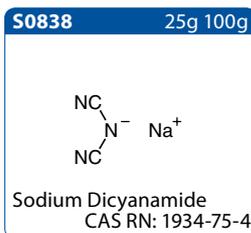
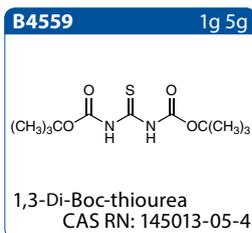
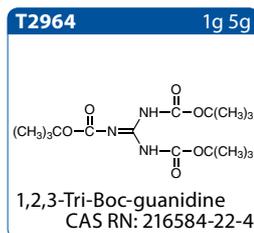
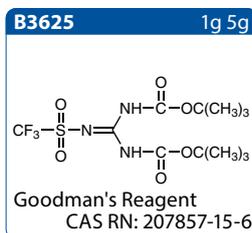
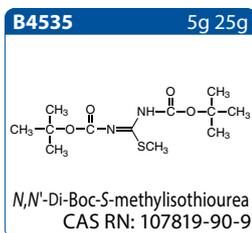
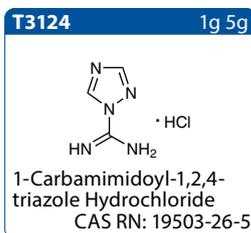
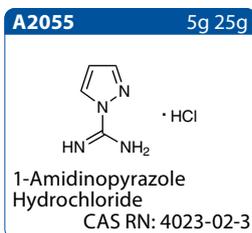
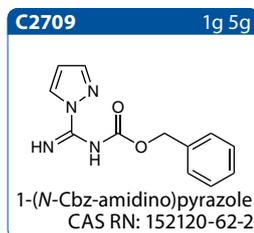
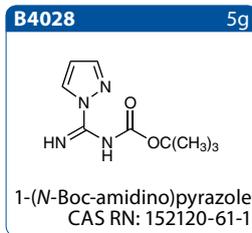
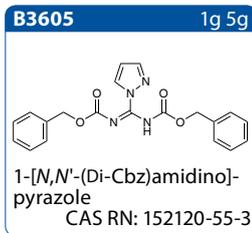
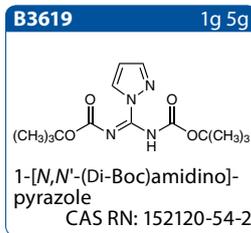
M0361 25mL  Acetone Cyanohydrin CAS RN: 75-86-5	D5514 5g 25g  Dimethylmalononitrile CAS RN: 7321-55-3	C1952 25g 300g CuCN Copper(I) Cyanide CAS RN: 544-92-3	T0990 25mL 100mL 500mL  Trimethylsilyl Cyanide CAS RN: 7677-24-9	C1242 5g 25g  Diethyl Cyanophosphonate CAS RN: 2942-58-7
		T0198 25g 500g  Benzyl Thiocyanate CAS RN: 3012-37-1	C0441 25g 500g  Ethyl Cyanoacetate CAS RN: 105-56-6	B1274 5mL 25mL  <i>tert</i> -Butyl Isocyanide CAS RN: 7188-38-7



アジド化・ジアゾ化試薬



グアニジニル化試薬



東京化成工業株式会社

試薬製品について

■本社営業部 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階
Tel: 03-3668-0489 Fax: 03-3668-0520 E-mail: Sales-JP@TCIchemicals.com

■大阪営業部 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-21 第2中井ビル1階
Tel: 06-6228-1155 Fax: 06-6228-1158 E-mail: osaka-s@TCIchemicals.com

スケールアップ、受託サービス(合成・開発・製造)について

□化成品営業部 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階
Tel: 03-5651-5171 Fax: 03-5640-8021 E-mail: finechemicals@TCIchemicals.com

弊社製品取扱店

本誌掲載の化学品は試験・研究用にのみ使用するものです。化学知識のある専門家以外の方のご使用はお避けください。品目や製品情報等、掲載内容の変更を予告なく行う場合があります。内容の一部または全部の無断転載・複製はご遠慮ください。